PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-145255

(43)Date of publication of application: 20.08.1984

(51)Int.CI.

CO9B 31/072 CO9B 45/28

(21)Application number: 58-017535

17525 (7

(22)Date of filing:

07.02.1983

(71)Applicant : NIPPON KAYAKU CO LTD

(72)Inventor: SATO GIICHI

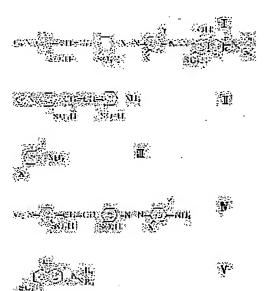
MATSUO TADASHI TABEI TATSU

(54) WATER-SOLUBLE DISAZO COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a water-soluble disazo compd. which gives a polarizing film having excellent dichroism and fastness and makes it possible to greatly increase the range of its use which has been limited hitherto, consisting of a free acid having a specified structural formula, and to provide a copper complex salt thereof.

CONSTITUTION: The titled water-soluble disazo compd. is obtd. from a free acid of formula I (wherein X is H, methyl, methoxy, ethoxy; Y is methoxy, ethoxy; R1 is H, methyl, -C2H4OH, benzene, phthalic acid, benzenesulfonic acid). The compd. of formula II is diazotized and coupled with a coumpd. of formula III. The resulting monoazo compd. of formula IV is diazotized and coupled with a compd. of formula V to obtain the water-soluble disazo compd. of formula I . If desired, the compd. is treated with copper sulfate to obtain a copper complex salt.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

報(B2) ⑫特

平2-61988

⑤Int.Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

平成2年(1990)12月21日

C 09 B 31/072 45/28

7433-4H 7433-4H

発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 水溶性ジスアゾ化合物

印特 顧 昭58-17535 每公 昭59-145255

22出 ` 瓩 昭58(1983)2月7日 ❸昭59(1984) 8 月20日

@発 明 者

者

佐 廢 鑫

東京都北区志茂 5-10-5 埼玉県鴻巣市箕田475-2

@発 明 者 明

尾

Œ 達

埼玉県北本市東間 8.丁目90-50

る出 頭 人

@発

EE 部 井

日本化築株式会社 少代 理.人 弁理士 竹田 和彦

査 官

1

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

切特許請求の範囲

1 遊離酸として一般式

$$O_2N- \bigcirc O_1N- \bigcirc O_2N- \bigcirc O_2N- \bigcirc O_3N- \bigcirc O_3N$$

(式(I)においてXは水素原子、メチル基、 メトキシ基又はエトキシ基を、Yはメトキシ基又 10 で表わされる水溶性ジスアゾ化合物又はこの銅錯 はエトキシ基を、Riは水素原子又はメチル基を、 R。は水素原子、メチル基、一C。H4OH基、

位置は6又は7位である)

塩化合物。

発明の詳細な説明

本発明は水溶性ジスアゾ化合物に関する。更に 詳しくは遊離酸として一般式

基を表わし、

(I) SO₃H SO₃H

20

(式(I)においてXは水素原子、メチル基、 メトキシ基又はエトキシ基を、Yはメトキシ基又 はエトキシ基を、R₁は水素原子又はメチル基を R₂は水素原子、メチル基、-C₂H₄OH基、

$$SO_3H$$
 基を表わし、 $-N$ R_2 基の

位置は6又は7位である。)で表わされる水溶性 ジスアゾ化合物又はこの銅錯塩化合物に関する。

本発明の化合物はセルロース繊維の染色にも用 15 いることが出来るが、主な使用目的は偏光膜の製造用である。従来、偏光膜用の着色剤としてはヨウ素が用いられているが、耐昇華性が劣り、熱安定性が低いので使用される分野が制限されていた。本発明の目的は耐久性の優れた偏光膜着色用*20

*の化合物を提供することにある。

本発明の水溶性ジスアゾ化合物は一般的には次のように製造される。

即ち式

$$O_2N O_2H$$
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H

で示される化合物を常法によりジアゾ化し、

웇

$$\begin{array}{c}
Y \\
NH_z
\end{array}$$

(式 (Ⅲ) 中XおよびYは前記と同じ意味を表わす。)

で示される化合物とカップリングし、

尤

$$O_2N$$
- O_2N - O_3H SO_3H X
 Y
 $N=N$ - $N=N$
 N

(式 (IV) 中、XおよびYは前記と同じ意味を 表わす。)

で示されるモノアゾ化合物を製造し、このものを 更にジアゾ化して式

(式 (V) 中、R1, R2は前記と同じ意味を表

る)で示される化合物と常法によりカップリング し、式(I)の水溶性ジスアゾ化合物を製造す 40 る。更に必要に応じ硫酸銅等で処理して式(I) で示される化合物の銅錯塩化合物をえる。

式 (I) の化合物は通常ナトリウム塩として製造するが、それらは遊離酸として、あるいはカリ

ウム塩、リチウム塩、アンモニウム塩、アルキルアミン、エタノールアミン類の塩として製造することが出来る。

式 (Ⅲ) に相当する化合物の具体的な例として

$$OCH_3$$
 OCH_3 $OCH_$

$$OCH_3$$
 OC_2H_5 OC_1H_2 , OC_2H_5 OC_2H_5

30

35

示される化合物の具体的な例としては、J酸、N ーメチル「酸、Nー2ーヒドロキシエチル」酸、 フエニール」酸、Nーメチルーフエニール」酸、 (3又は4-カルボキシ) フエニール J酸、N-メチルー(3又は4ーカルポキシ) フエニール J 酸、(3又は4ースルホ) フエニール J酸、Nー. メチルー(3又は4ースルホ)フエニール J酸、 γ酸、N-メチルγ酸、N-2-ヒドロキシエチ ルγ酸、フエニールγ酸、N-メチルフエニール 7酸、(3又は4-カルボキシ)フエニール7酸、10 天然のポリマー又はナイロンのようなポリアミド N-メチルー(3又は4ーカルボキシ)フエニー・ ルγ酸、(3又は4ースルホ) フエニールγ酸、 Nーメチル (3又は4ースルホ) フエニール7酸

本発明の化合物は通常の染色法で木綿、スフ、15 て百分率は重量による。 ピスコース、レーヨン、紙、パルブなどのセルロ ース基質にも良く染着するのでこれらの基質の染 色にも有用であるが、特に二色性を有する偏光膜 用着色剤として価値がある。

等があげられる。

が高いこと、可視光全領域について光吸収性を有 していること等の理由で広く用いられているが、 堅牢性に乏しく熱あるいは光に曝露されると消色* *したり昇華したりして効果が著しく低下する欠点 がある。

式(I)のジスアゾ化合物又はその銅錯塩化合 物を偏光素子として用いるとこの様な欠点が解消 5 され、二色性と堅牢性の優れた偏光膜を得ること が出来、従来限定されていた用途を大幅に拡大す ることが出来る。

偏光膜製造の為の素材としてはポリビニルアル コール、セロフアン等の水酸基をもつた合成又は 系樹脂又はリビニルアルコールと酢酸ビニルとの 共重合物からえられる膜等が用いられる。

次に実施例により本発明をさらに詳しく説明す る。これらの実施例に於て部は重量により、そし

実施例 1

4-二トロー4ーアミノスチルベンー2,2ー ジスルホン酸ソーダ57.7部を常法によりジアゾ化 し、酢酸ソーダを中和剤として使用し2ーメトキ 従来、ヨウ素を偏光素子とする偏光膜は偏光率 20 シー5ーメチルアニリン18.7部を塩酸水溶液に溶 解したものにカップリングする。反応が終了した ら塩酸で酸析し沪過、乾燥すれば67.9部のモノア ソ化合物(次式)が得られる。

$$O_2N$$
- CH = CH - O_3H O_3H

このモノアゾ化合物67.9部を水1700部に苛性ソ ダ10.3部を溶解する。別に水160部、35%塩酸73 部で塩酸水溶液を作り、これに前記のモノアゾ化 合物と苛性ソーダ、亜硝酸ソーダとの混合溶液を 滴下して5~10℃でジアゾ化する。ジアゾ化が終 了したら、スルフアミン酸を加えて亜硝酸イオン≋35 553nmであつた。

×を消去する。フエニール J 酸40.3部を10%ソーダ ーダ11.7部と共に溶解し、この溶液に亜硝酸ソー 30 灰水溶液1000部に溶解し、前記ジアソニウム塩を 加え5~10℃でカップリングする。一夜攪拌後生 成した沈澱を沪別し乾燥すれば75.3部の次式の水 溶性ジスアゾ化合物が得られる。このジスアゾ化 合物をPH9.5の緩衝液に溶解した時のAmaxは

$$O_2N$$
 O_2N
 O_2N
 O_3H
 O_3H

実施例

実施例1においてフエニールJ酸40.3部の代り に7酸30.5部を使用することを除いて実施例1と

同様にして69.2部の水溶性ジスアゾ化合物(次 式)を得た。

— 191 —

7

$$O_2N$$
 O_2N
 O_3H
 O_3H

このものをPH9.5の緩衝液に溶解した時のλmax は562nmであつた。

実施例 3

実施例 1 のジスアゾ化合物75.3部を1200部の水 る銅錯塩化合物の粉末が得られた。この染料を出 に溶解しCuSo₄・5H₂Oの20%水溶液110部、N, 10 9.5の緩衝液に溶解した時のλmaxは、598nmであ Nージェタノールアミン60部、25%アンモニア水* つた。

*15部を加え95℃で8時間処理した。少量の塩酸でこの反応液をPH9.0とし液容量に対し12%の食塩を加え生成した沈澱を沪別乾燥して次式で示される銅錯塩化合物の粉末が得られた。この染料を円9.5の緩衝液に溶解した時のλmaxは、598nmであった。

$$O_2N$$
 O_2N
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_2N
 O_3H
 O_2N
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H
 O_3H

偏光膜の製造: ドクターコーター及び送風型乾燥機を備えたコーテイング装置を用いて製膜したポリピニールアルコールフイルムを実施20例1,2又は3で得られた化合物10gを10ℓの水に溶解してえた40℃の溶液中に1.5分間浸漬した後流水で洗浄すると、青色に染色された膜が得られる。この膜をロール型延伸機を用いて縦方向に3.5倍に延伸して偏光膜を25得た。この様にして得られた偏光膜の光線透過度を測定した結果を下表に示す。

化合物の 種類	Y ₁ (%)	Υ (%)	Υ _⊥ (%)	ρ (%)
実施例 1 の染料	49. 13	35,63	10,75	73, 23
実施例 2 の染料	50.13	37.87	11.56	72,95
実施例3 の染料	45.48	32, 54	9,64	73.68

〔注〕 表の値は波長380~740nmの範囲で求めた視感透過率で、Y1は単板、Y || は延伸方向に2枚平行に重ね合わせた場合、またY || は延伸方向に直交して重ね合わせた場合の値で示し、ρは

$$\sqrt{\frac{Y_1 - Y_\perp}{Y_1 + Y_\perp}} \times 100(\%)$$
 の式よ

り算出した値を示す。 p の値が大きい 程偏光膜としてすぐれていることを示 す。

実施例 4~11

式(II) および(V)の化合物として表に示された化合物を用い実施例1~3と同様にして製造したジスアゾ化合物又はそれらを銅錯塩化してえ30 た化合物をPH9.5の緩衝液に溶解した時のλmaxおよびそれらの化合物を用いて実施例3と同様に偏光膜を作製した場合のρの値を以下の表に示した。

実施例	式(皿)の化合物	式(V)の化合物		銅錯塩化 の有無	
4	2-メトキシ5-メチルアニリン	J酸	な	L	
Ŝ	同上	〕酸	ぁ	ŋ	
6	同上	(4ーカルポキシ)フェニールγ酸	な	L	
7	2,5-ジメトキシアニリン	フェニール」酸	な	r.	
8	2-メトキシ-5-メチルアニリン	N-2-ヒドロキシエチル7酸	な	L	
9	同 上	(4ーカルボキシ)フエニール]酸	な	L	
10	2,5-ジメトキシアニリン	γ酸	な	L	
11	同上	(4ーカルボキシ)フエニール]酸	な	L	

化合物の種類	λ max(nm)	Y1(%)	Y (%)	Y_(%)	p (%)
実施例4の化合物	543	42, 95	30.54	6, 51	80,55
実施例 5 の化合物	592	39, 38	27,28	6. 10	79, 65
実施例 6 の化合物	494	39, 79	26,12	5.14	81, 92
実施例7の化合物	572	43, 80	32,41	6, 90	80, 57
実施例8の化合物	*482, 577	39, 85	27,60	3,30	88, 67
実施例 9 の化合物	559	37, 88	25,38	3.92	85, 59
実施例10の化合物	575	44, 93	32, 43	8,09	77.51
実施例11の化合物	573	37, 55	24.76	4,48	83, 27

* 2点で同じ吸光度を示した。

実施例 12~18

30 を製造しpH9.5の緩衝液に溶解しそのAmaxを測定

実施例1,2,3と同様に操作して表に示され

した。

る式 (Ⅲ), (V) の化合物を用いジスアゾ化合物

結果は次表の通りである。

実施例	式(皿)の化合物	式(V)の化合物	銅錯塩化 の有無	λ max(nm)
12	2-メトキシ-5-メチルア ニリン	4-スルホフエニールγ酸	なし	571
13	2,5-ジメチルアニリン	3-スルホフエニールγ酸	なし	580
14	2-メトキシ-5-メチルア ニリン	トメチルγ酸	なし	568
15	2,5-ジメトキシアニリン	4-カルボキシフエニール γ酸	なし	582
16	同上	4-スルホフエニールJ酸	あり	608

.12

実施例	式(Ⅲ)の化合物	式(V)の化合物	銅錯塩化 の有無	λ max(nm)
17	2-メトキシ-5-メチルア ニリン	N, N-ジメチルJ酸	あり	603
18	2,5-ジェトキシアニリン	フエニールJ酸	なし	575